# 激光写光电子学进展

# 半导体可饱和吸收镜锁模激光器研究进展

黄婷<sup>1,2</sup>,林楠<sup>1\*</sup>,张秋月<sup>1,2</sup>,何天将<sup>1,2</sup>,熊聪<sup>1</sup>,仲莉<sup>1,2</sup>,刘素平<sup>1</sup>,马骁字<sup>1,2</sup> <sup>1</sup>中国科学院半导体研究所光电子器件国家工程研究中心,北京 100083; <sup>2</sup>中国科学院大学材料科学与光电技术学院,北京 100049

摘要 半导体可饱和吸收镜(SESAM)作为超快激光技术中最常用的被动锁模器件,由于可自启动、插入损耗小、集成度 高和设计灵活等优点,具有广泛的应用范围和极佳的商业前景。本文主要介绍SESAM的锁模原理和发展现状,对目前 SESAM的外延结构、生长方式和参数性能进行总结归纳,详尽描述其在固体激光器、半导体激光器和光纤激光器的锁模 最新进展,并指出各类锁模激光器的性能特点和未来发展方向。

关键词 半导体可饱和吸收镜;被动锁模;激光器;超快激光 中图分类号 TN248 文献标志码 A

DOI: 10.3788/LOP231330

# Progress in Semiconductor Saturable Absorption Mirror Mode-Locked Laser

Huang Ting<sup>1,2</sup>, Lin Nan<sup>1\*</sup>, Zhang Qiuyue<sup>1,2</sup>, He Tianjiang<sup>1,2</sup>, Xiong Cong<sup>1</sup>, Zhong Li<sup>1,2</sup>, Liu Suping<sup>1</sup>, Ma Xiaoyu<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>National Engineering Research Center for Optoelectronic Devices, Institute of Semiconductor, Chinese Academy of Science, Beijing 100083, China;

<sup>2</sup>College of Materials Science and Opto-Electronic Technology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

**Abstract** Semiconductor saturable absorption mirror (SESAM) is the most commonly-used passive mode-locking device in ultrafast laser technology. Owing to its advantages of self-starting, low insertion loss, high integration, and flexible design, SESAM has a wide range of applications and excellent commercial prospects. This study introduces the mode-locking principle and current development status of SESAM and summarizes the current epitaxial structure, growth mode, and parameter performance of SESAM. It also provides a detailed description of its latest progress in mode-locking in solid-state, semiconductor, and fiber lasers. Moreover, the performance characteristics and future-development direction of various types of mode-locked lasers are presented.

Key words semiconductor saturable absorption mirror; passive mode-locking; laser; ultrafast laser

1引言

近年来,随着超短脉冲激光器的迅速发展,ps和fs 激光器凭借其短脉冲宽度、高峰值功率和宽光谱等优 势已广泛应用于光纤通信、高精细加工、激光测距、生 物学、医学等诸多领域<sup>[1]</sup>。锁模技术是获得超短脉冲 的主要方式之一,自1992年Keller等<sup>[2]</sup>发明半导体可 饱和吸收镜(SESAM)以来,SESAM作为锁模器件已 经成功应用于光纤激光器<sup>[3]</sup>、固体激光器<sup>[2]</sup>和半导体垂 直外腔表面发射激光器<sup>[4]</sup>,并基于此获得不同特点的 超短脉冲。其中,SESAM锁模光纤激光器脉冲宽度 小,锁模固体激光器峰值功率高,锁模半导体垂直外腔 表面发射激光器重复频率和输出功率高。

自20世纪90年代 SESAM 锁模和克尔透镜锁模 (KLM)面世以来,被动锁模技术取得了关键性突破, 打破了超短脉冲依赖于染料激光器和主动锁模激光器 的技术困境。1991年,Spence等<sup>[5]</sup>首次报道了钛蓝宝 石激光器利用克尔效应产生60 fs的超短脉冲激光输 出,从此克尔透镜锁模进入人们的研究视野。KLM可 以在没有任何外部脉冲压缩的情况下将激光脉冲锁模

收稿日期: 2023-05-18; 修回日期: 2023-07-06; 录用日期: 2023-07-24; 网络首发日期: 2023-08-07 通信作者: \*linnan@semi.ac.cn

至几fs范围,然而,KLM锁模过程存在不能自启动的 缺点,而且需要关键的空腔对准来获得稳定的脉冲,因 此KLM与腔体匹配的问题限制了激光输出功率和效 率的提升。除了SESAM外,石墨烯和碳纳米管也可 作为新型锁模器件,具有非线性吸收特性。与 SESAM相比,碳纳米管可饱和吸收体更容易制备,更 抗损伤,但是需通过调节纳米管直径来得到不同的工 作波长,而且存在宽谱调谐差的问题。石墨烯可饱和 吸收体光谱工作范围宽,损伤阈值高,但还需解决性能 可控差的问题,且目前难以实现商品化。

SESAM具有可自启动、插入损耗小、集成度高、 设计灵活和支持全固态激光技术等优点,成为各类激 光器的首选锁模器件,因此,大量基于 SESAM 被动锁 模的各种类型激光器的研究成果被报道。首先阐述 SESAM 锁模原理,其次总结归纳 SESAM 的发展现 状,最后总结和分析其应用于各类激光器中所呈现的 结构、生长方式和参数性能。

# 2 SESAM的锁模原理

SESAM由布拉格反射镜和半导体可饱和吸收体结合而成,一般以高反射率的布拉格反射镜作为底部反射镜,布拉格反射镜上面外延生长半导体材料或者量子阱结构作为吸收层,顶部生长高反射率介质膜或

#### 第 61 卷第 9 期/2024 年 5 月/激光与光电子学进展

直接将半导体-空气界面作为顶部反射镜。高反射率 的反射镜可以在工作中减少非线性损耗,并充当谐振 腔的全反镜。当SESAM工作时,可饱和吸收体吸收 激光的光子能量,发生如图1(a)所示的载流子跃迁, 价带中的载流子被激发至导带,并在不同能量激光下 表现出不同的饱和状态:当弱能量激光辐射 SESAM 时,难以使SESAM达到饱和,从而产生较大损耗;而 当强能量激光辐射 SESAM 时, SESAM 中的可饱和吸 收材料的载流子发生跃迁,基态和激发态的载流子达 到平衡,吸收达到饱和,强能量激光损耗较小。图1(a) 的双时间吸收效应分别发生在激发过程的百 fs 时间 内,能带中的载流子热化导致吸收的部分恢复,在几 ps到几ns的时间内,载流子通过复合和俘获回到价 带,可饱和吸收体再次恢复吸收特性,开始新一轮的可 饱和吸收过程<sup>[6]</sup>。在 SESAM 被动锁模激光器的谐振 腔内,SESAM使谐振腔内原本强度起伏不定的自发 辐射激光经过相同的增益和相差悬殊的损耗后,强能 量激光形成稳定振荡,弱能量激光衰减殆尽,形成如 图 1(b) 所示的周期为 2L/c(L为谐振腔长度) 的超短 脉冲激光。SESAM内的高激发能级寿命和激光工作 物质中的纵向弛豫时间共同决定了SESAM的自启动 锁模特性,并通过SESAM的恢复时间对激光脉冲进 行选择以达到整形目的<sup>[7]</sup>。



#### 图 1 SESAM 锁模原理图<sup>[6]</sup>。(a)双时间吸收效应;(b) SESAM 锁模激光器脉冲 Fig. 1 Principle diagram of SESAM mode-locking<sup>[6]</sup>. (a) Bitemporal absorption response; (b) pulse of SESAM mode-locking laser

SESAM的宏观参数包含调制深度、饱和通量、饱 和强度、非饱和损耗和恢复时间,这些性能参数直接影 响其锁模能力和应用范围<sup>[8]</sup>。调制深度反映可饱和吸 收体被强激光脉冲漂白的能力,高调制深度的 SESAM更容易锁模和产生短的脉冲,但也将带来过 大的非饱和损耗;饱和通量可用来表征SESAM实现 锁模时所需的脉冲通量,过高的饱和通量会使入射通 量接近损伤阈值从而发生光学损伤,过低的饱和通量 则容易发生多脉冲现象;非饱和损耗主要来源包括底 部反射镜没有对光全反射而对入射光能量的吸收和透 射损耗、样品表面不平整引起的散射损耗以及缺陷、杂 质等引起的其他吸收损耗,非饱和损耗不仅会降低激 光器的效率还会引起SESAM的损伤;恢复时间受可 饱和吸收体的双时间吸收效应影响,决定超短脉冲激 光的脉冲宽度。调制深度、饱和通量和饱和强度这3 个宏观参数不仅取决于制备SESAM的材料性质还取 决于器件的结构设计,因此可通过调节半导体材料、改 变生长方式和结构类型等途径对SESAM进行灵活设 计以满足不同激光器的需求。

# 3 SESAM的研究现状

自 SESAM 成功锁模以来,人们对 SESAM 进行 了理论完善和结构创新,分别从器件的底部反射镜、吸 收层和顶部反射镜的材料、生长方式等方面进行新尝 试,并采取衬底去除技术优化散热,以此提升 SESAM 性能和与激光器的适配性。

理论研究方面,1993年,Keller等<sup>[9]</sup>报道了SESAM 的双时间吸收效应,分析了生长温度对载流子的双时

间吸收寿命的影响,载流子发生带间复合的时间常数 随着生长温度的降低而降低,并研究了其对连续锁模 Nd:YLF和Nd:YAG激光器的自启动和调Q动力学, 载流子寿命越长,调Q越难抑制。该理论通过调整 SESAM的载流子寿命和顶部反射器的方式优化 SESAM的自启动性能,抑制连续波锁模固体激光器 的调Q,以实现更稳定的锁模。1995年,Kärtner等<sup>[10]</sup> 系统地建立了固体激光器动力学的基本模型,并推导 出固体激光器在调Q、调Q锁模和稳定锁模不同工作 状态的边界条件,研究表明可以通过低温生长可饱和 吸收材料得到一个抑制调Q、完全自启动锁模、恢复 时间快速的SESAM。动态理论的完善为开发和设计 稳定、紧凑的超短脉冲固体激光提供了有效理论 指导。

在底部反射材料方面,1996年,Fluck等<sup>[11]</sup>采用银 镜作为SESAM的底部反射镜。利用宽反射带的银镜 代替折射率小的AlAs/AlGaAs布拉格反射镜,并将制 得的SESAM作为锁模自启动机制的关键器件,在钛 宝石激光器中获得短至10 fs的激光脉冲。银镜作为 底部反射材料提供了良好的散热,提高了器件的抗损 伤能力。2002年,张志刚等<sup>[12]</sup>利用金膜作为底部反射 镜制作出宽带低损耗的SESAM,并成功用于钛宝石 飞秒脉冲激光器的自启动锁模。金属膜相对于半导体 的布拉格反射镜具有反射率高、带宽宽等优点,但其与 后续生长的半导体材料的兼容性较差。

顶部反射镜决定了穿透和漂白可饱和吸收体的光量,对饱和通量和调制深度等特性参数也有一定影响。可以通过改变顶部反射镜的反射率调节SESAM的精细度,甚至用增透膜代替反射镜即顶部反射率为0,得到无谐振 SESAM,通过调节反射镜厚度可以改变SESAM内部场强分布,从而设计出不同结构类型的SESAM<sup>[13]</sup>。1996年,Fluck等<sup>[14]</sup>报道了用于被动锁模激光器的高精细度和低精细度两种SESAM;高精细

#### 第 61 卷第 9 期/2024 年 5 月/激光与光电子学进展

度 SESAM 载流子寿命为 9.5 ps, 最大调制深度为 0.2%,饱和通量为30 mJ/cm<sup>2</sup>;低精细度SESAM 载流 子寿命为4 ps,最大调制深度为2%,饱和通量为 0.4 mJ/cm<sup>2</sup>,低精细度 SESAM 由于更高的调制深度 可获得更短的脉冲。1997年, Jung等<sup>[15]</sup>采用Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>增 透膜取代顶部反射镜得到无谐振型 SESAM,得到调 制深度为4.9%、饱和通量为18 μJ/cm<sup>2</sup>的SESAM。 顶部反射镜反射率为0的无谐振型 SESAM 内部存在 更大的场强,因此调制深度更大。实验结果表明,顶部 反射镜的反射率越大,SESAM的调制深度越小。 2004年, Grange等<sup>[16]</sup>报道了以GaInNAs材料为吸收 区材料的 SESAM,可以自启动被动锁模 1.3 µm 的 Nd: YLF 激光器,获得亚 10 ps 的激光脉冲。对比如 图 2(a)、(b) 所示的反谐振型和谐振型两种类型 SESAM 的电场分布和非线性反射率可知,谐振型和 反谐振型 SESAM 的饱和通量分别为 1.5 µJ/cm<sup>2</sup>和 11.2 µJ/cm<sup>2</sup>, 调制深度分别为 3.9% 和 0.6%, 非饱和 损耗分别为0.3%和0.04%。研究表明,在SESAM 的结构设计中,可根据可饱和吸收材料在结构层中的 具体位置进行优化,谐振设计的吸收区靠近入射表面, 量子阱吸收区的内部场强明显增加,反射率在吸收波 长处明显下降,这是由于更高场强量子阱吸收区发生 更大吸收和损耗<sup>[13]</sup>。2005年, Spühler<sup>[17]</sup>将图2(a)中谐 振结构的 SESAM 命名为低场强谐振型 SESAM (LOFERS),并报道了一种介于经典反谐振 SESAM 结构和 LOFERS 结构之间的增强型 SESAM,即在 SESAM 表面沉积 1/4 波长厚度的 SiO<sub>2</sub>(折射率低于 DBR中低折射率材料),这类新型 SESAM 可有效降 低饱和通量,更适用于高重复频率的被动锁模,如 图 2(c) 所示。总之, 不同的 SESAM 结构可以明显地 改变吸收区的内部场强分布,对SESAM的调制深度 和饱和通量有明显影响,是调节这两种参数的常用 方式。



图 2 各类 SESAM 结构对比<sup>[13,17]</sup>。(a)谐振型(实线)和反谐振型(虚线)结构图;(b)谐振型(实线)和反谐振型(虚线)反射率图; (c)增强型 SESAM 结构图

Fig. 2 Comparison of SESAM structures<sup>[13,17]</sup>. (a) The structure diagrams of resonance (solid line) and anti-resonance (dashed line);
 (b) the reflectance diagrams of resonance (solid line) and anti-resonance (dashed line);
 (c) the structure diagrams of enhanced SESAM

1997年, Fluck 等<sup>[18]</sup>采用 SiO<sub>2</sub>/HfO<sub>2</sub>作为 SESAM 的高反射膜,在激光波长处反射率为 50%,该 SESAM

的恢复时间大于 300 ps, 饱和通量为 670 μJ/cm<sup>2</sup>, 调制 深度为 7%, 非饱和损耗为 10%。2008年, Marchese

#### 第 61 卷第 9 期/2024 年 5 月/激光与光电子学进展

等<sup>[19]</sup>报道了由电子束蒸发沉积的两对交替生长的SiO<sub>2</sub>/Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>顶部反射镜,顶部反射镜将该SESAM内部的光场强度降低到未沉积顶部反射镜时的30%,从而增加SESAM的饱和通量。该SESAM的饱和通量约为115 μJ/cm<sup>2</sup>,调制深度约为0.6%,非饱和损耗小于0.1%,恢复时间为48.5 ps。2011年,Saraceno等<sup>[20]</sup>系统地研究了应用于高功率激光器的SESAM的寿命与损伤,报道了不同顶部反射镜SESAM的非线性反射率和寿命,没有顶部反射镜的SESAM(NTC)为一个标准的3QWs反谐振SESAM,具有初

始的饱和通量和基于 3QWs 吸收层的高调制深度,在 该类标准 SESAM上分别沉积 3种不同的顶部反射 镜,1/4 波长 GaAs/AlAs 半导体材料(SCTC)和 2 对 及 3 对 1/4 波长 SiO<sub>2</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 介质膜材料(DTC2 和 DTC3),各类 SESAM的宏观参数如表1所示。实验 数据表明,介质膜层数较多的 SESAM样品具有更高 的损伤阈值和更长的寿命。顶部反射镜作为光进入 SESAM 的重要部分,对控制光通量和影响器件的寿 命有重大意义,合理的介质膜设计可以有效改变器件 性能参数。

表1 不同 SESAM 的非线性参数、实测损伤阈值  $F_4$ 和相应的饱和参数  $S^{[20]}$ 

Table 1 Nonlinear parameters of the different tested SESAMs, measured damage thresholds  $F_{d}$  and corresponding

| saturation parameter $S^{[20]}$ |  |                                  |  |  |  |                                      |  |
|---------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|
| SESAM                           | Saturation fluence<br>$F_{\rm sat} / (\mu J/cm^2)$ | Modulation depth $\Delta R / \%$ | Nonsaturable loss $\Delta R_{ns} / \%$ | Inverse saturable<br>absorption $F_2/(\mu J/cm^2)$ | Damage fluence $F_{\rm d} / (\rm mJ/cm^2)$ | Corresponding saturation parameter S |  |
| NTC                             | 72   | 2.05                             | 0.04                                   | 3200   | 32.6                                       | 452                                  |  |
| SCTC                            | 279  | 0.52                             | 0.01                                   | 5523   | 44.1                                       | 157                                  |  |
| DTC2                            | 168  | 0.71                             | 0.02                                   | 31700  | 122  | 726                                  |  |
| DTC3                            | 247  | 0.43                             | 0.04                                   | 346000   | >210                                       | >850                                 |  |

在吸收层方面,量子阱的材料直接影响 SESAM 的吸收波长,且量子阱的数量、生长温度和生长方式都 会影响 SESAM 的性能参数。2008年, Marchese 等<sup>[19]</sup> 报道了基于 SESAM 被动锁模 Yb: YAG 薄片激光器, 采用双量子阱结构即两个7 nm 厚的 InGaAs 量子阱嵌 入GaAs中,通过增加吸收区量子阱数量增大器件对 光的吸收从而增大器件的调制深度,以实现稳定锁模。 2012年, Saraceno等<sup>[21]</sup>进一步研究了 250~385 ℃之间 的不同低温条件下生长的 SESAM 量子阱,并评估了 生长温度对样品非饱和损耗、损伤阈值和恢复时间的 影响,低温生长会增加材料内部缺陷,从而形成电子和 空穴的复合中心,可以有效降低恢复时间,但过多的缺 陷会导致材料恶化,增大器件的非饱和损耗和降低损 伤阈值。2016年, Alfieri等<sup>[22]</sup>报道了使用 MOCVD生 长的 SESAM 吸收区,与之前 MBE 的外延方式相比会 引入更多的量子阱缺陷从而具有更快的恢复机制,同 时采用低双光子吸收系数(TPA)的应变材料对量子 阱进行应变补偿,可以保证较低的表面缺陷密度,维持 低的非饱和损耗。利用该优势生长出大数量应变补偿 量子阱[23],可得到更高调制深度、低饱和通量和高损伤

阈值的 SESAM, 如表 2 所示, 其中: 1×3 SQW 表示 1个波腹处有3个应变补偿量子阱;6×1 SCQW表示 6 个 波 腹 处 分 别 存 在 1 个 应 变 补 偿 量 子 阱 : 8× 1 SCQW 表示 8 个波腹处分别存在1 个应变补偿量子 阱;4×2 SCQW表示4个波腹处分别存在2个应变补 偿量子阱。目前可以通过改变量子阱数量、生长温度 和生长方式的方法定性地改变 SESAM 宏观参数,指 导 SESAM 制备。除了传统的量子阱吸收区,低饱和 通量的量子点吸收区也为SESAM的非线性吸收提供 了新方向<sup>[24]</sup>。动态增益饱和锁模要求 SESAM 的饱和 强度必须大于激光器的增益强度[25],但增益结构和 SESAM 的吸收区通常基于相同材料体系的量子阱, 为了实现稳定锁模,则要求 SESAM 的吸收区模式面 积大于增益区,而低饱和通量的量子点 SESAM (QD-SESAM)放宽了模式尺寸要求,为SESAM和 VECSEL集成提供可能性,成功制得锁模集成外腔表 面发射激光器<sup>[26]</sup>,且利用QD-SESAM锁模得到目前 输出功率最大的半导体锁模激光器<sup>[27]</sup>。QD-SESAM 虽然有更好的设计灵活度,但是恢复时间较长,且稳定 性差,逐渐被低温生长的量子阱结构取代。2020年,

表2 非线性参数、损伤阈值和恢复时间<sup>[22]</sup>

| Table 2 Measured nonlinear parameters, damage threshold, and recovery time <sup>[22]</sup> |  |                                 |   |   |   |   |                               |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|
| SESAM  | Saturation<br>fluence F <sub>sat</sub> /<br>(µJ/cm²) | Modulation depth $\Delta R$ / % | Nonsaturable $\log \Delta R_{ m ns} / \%$ | Inverse saturable<br>absorption<br>$F_2/(\mu J/cm^2)$ | Reflectivity<br>rollover fluence<br>F <sub>0</sub> /(µJ/cm <sup>2</sup> ) | Damage<br>fluence $F_{ m d}$ /<br>( $\mu$ J/cm <sup>2</sup> ) | Recovery time $	au_{1/e}$ /ps |  |
| $1 \times 3$ SQW   | 120  | 1.1                             | 0.10                                      | 6.0   | 3.9   | 64  | 67                            |  |
| $6 \times 1$ SCQW  | 174  | 1.0                             | 0.14                                      | 10  | 5.8   | 112   | 15                            |  |
| $8 \times 1$ SCQW  | 334  | 1.3                             | 0.14                                      | 9.0   | 8.2   | 108   | 17                            |  |
| $4 \times 2$ SCQW  | 246  | 1.2                             | 0.18                                      | 9.2   | 7.0   | 88  | 12                            |  |

Finke 等<sup>[28]</sup>报道了一个具有高质量 In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As/GaAs 量子点的反谐振 SESAM,其展示的温度稳定性表明 QD-SESAM仍然具有开发潜力。

在衬底去除方面,为了提高SESAM的损伤阈值, 提升器件的散热性能,2015年,Diebold等<sup>[29]</sup>报道了用 于 kW 超快激光的SESAM,采用不同的衬底去除技 术,在不改变器件非线性性能的前提下,得到更好的散 热性能和表面质量。次年,Diebold等<sup>[30]</sup>比较了标准 SESAM样品和采用不同封装技术去除衬底后的 SESAM样品的温升、热透镜和表面变形。热效应都 与吸收功率呈线性比例,封装技术可影响SESAM的 温升强度和热透镜,衬底去除可有效增强器件的导热, 提升SESAM的散热和损伤阈值。

在众多实验的验证下,SESAM的锁模理论得到 完善,器件的性能也得到明显的改善,简便实用的 SESAM已成为最具商业价值的锁模器件。SESAM 技术的完善对促进超短脉冲固体、半导体和光纤激光 器的发展具有重要意义,从而进一步推动超快激光领 域的进程。

# 4 SESAM锁模激光器的研究进展

### 4.1 SESAM锁模固体激光器

固体激光器由于能量大、峰值功率高、结构紧凑、 牢固耐用等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等方面, 固体激光器具有接近量子噪声极限的性能,适用于稳 定性要求高的应用。固体激光器被动锁模要求 SESAM具有高饱和通量、低调制深度和高损伤阈值。 自SESAM研制以来,锁模固体激光器一直是超短脉 冲激光领域的研究重点,文献[31]对早期锁模固体激 光器的性能进行了详细展示,本文主要综述近期发展 的薄盘激光振荡器(TDL)。

传统固体激光器沿着垂直光轴的横向进行热传 递,会因温度升高而引发热透镜效应导致光束质量变 差、能量损失增大,而薄盘式固体激光器可沿平行于光 轴的方向进行散热,达到消除晶体热透镜效应的目的, 可用于高功率激光领域。文献[32]综述了2012年之 前的被动锁模 TDL,本文着重综述近期发展,并在表3 中给出了参数概述。2000年,der Au等<sup>[33]</sup>首次使用

| Year | Reference | Gain material  | Wavelength / nm | Pulse<br>width /fs | Average<br>power /W   | Repetition<br>rate /MHz | Peak<br>power /W                           | Energy /µJ           |
|------|-----------|--|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 2000 | [33]      | Yb:YAG   | 1030            | 730                | 16.2                  | 34.6                    | 57.5                                       | 0.47                 |
| 2003 | [34]      | Yb:YAG   | 1030            | 810                | 60                    | 34.3                    | $1.9 \times 10^{6}$                        | 1.75                 |
| 2012 | [35]      | Yb:LuScO <sub>3</sub>  | 1040            | 96                 | 5.1                   | 77.5                    |  |                      |
| 2012 | [41]      | Yb:YAG   | 1030            | 583                | 25.6 $\times 10^{-3}$ | 16.3                    | 275  | 16.9                 |
| 2012 | [42]      | Yb:YAG   | 1030            | 1100               | $35 \times 10^{-3}$   | 3.5                     | 145  | 41                   |
| 2012 | [43]      | Yb:SSO   | 1036            | 298                | $3.5 \times 10^{-3}$  | 27                      | 27.8                                       | 1                    |
|      |           |  |                 | 300                | $3.8 \times 10^{-3}$  | 21                      | 28   | 1.3                  |
| 2012 | [44]      | Yb:CALGO   | 1043            | 197                | $4 \times 10^{-3}$    | 21                      | 20   | 0.9                  |
|      |           |  |                 | 135                | $0.2 \times 10^{-3}$  | 45                      | 1.3  | 0.03                 |
| 2012 | [45]      | Yb:CALGO   | 1050            | 94                 | 12.5                  | 80                      | $1.5 \times 10^{6}$                        | 0.15                 |
| 2013 | [36]      | Yb:CALGO   | 1051            | 62                 | 5.1                   | 65                      | $44 \times 10^{6}$                         | 0.08                 |
| 2014 | [37]      | Yb:Lu <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /Yb:Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1038            | 103                | 1.4                   | 41.7                    |  |                      |
| 2014 | [38]      | Yb:YAG   | 1030            | 1070               | 242                   | 3.0                     | $66 \times 10^{6}$                         | 80                   |
| 2017 | [46]      | Yb:Lu <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                    |                 | 498<br>260         | 58<br>16              | 11.2<br>47.2            | $9.2 \times 10^{6}$<br>$100 \times 10^{6}$ |                      |
| 2018 | [47]      | Yb:YAG   | 1030            | 580                | 120                   | 13.4                    | 13.6                                       | 9                    |
| 2018 | [48]      | Yb:YAG   | 1030            | 970                | 125                   | 78                      | $1.45 \times 10^{6}$                       | 1.6                  |
| 2018 | [49]      | Yb:YAG   | 1030            | 780                | 210                   | 10.9                    | $54 \times 10^{6}$                         | 19                   |
| 2019 | [39]      | Yb:YAG   | 1030            | 940                | 350                   | 8.9                     | $37 \times 10^{6}$                         | 39                   |
| 2020 | [40]      | Ho: YAG  | 2090            | 371                | 3.66                  | 24                      | 96   | 0.15                 |
| 2021 | [50]      | Ho:YAG   | 2050            | 1660               | 40.5                  | 52.2                    | 209  | $0.78 \times 10^{6}$ |
| 2022 | [51]      | Ho:YAG   | 2100            | 1130               | 50                    | 23.6                    | $1.9 \times 10^{6}$                        | 2.11                 |

表3 近年 SESAM 锁模薄盘激光器的发展 Table 3 Development of recent SESAM mode-locked thin disk lasers

SESAM 锁模 TDL,使用低精细度 SESAM 锁模 Yb: YAG 薄盘激光器, 诠释了全固体飞秒激光器的概念。 2003年, Innerhofer等<sup>[34]</sup>报道了SESAM被动锁模二极 管泵浦的 TDL,将薄盘减至 100 µm,平均功率提升到 60 W。2012年和2013年, Keller团队<sup>[35-36]</sup>均做出了低 于100 fs的锁模 TDL 的超短脉冲,通过宽增益谱增益 介质和短恢复时间 SESAM 相结合,报道了目前 SESAM 锁模 TDL 的 最短脉冲宽度。 2014年, Schriber 等<sup>[37]</sup>首次报道了 SESAM 锁模双增益介质的 TDL,双增益材料可达到比单一材料更宽的带宽,该 方法为百 fs 量级的薄盘激光器实现高功率输出提供了 新途径。2013年,Saraceno等<sup>[38]</sup>使用高损伤阈值、低损 耗 SESAM 锁模 TDL, 可产生 80 µJ 的脉冲能量。 2019年, Saltarelli等<sup>[39]</sup>报道的SESAM锁模TDL的最 高平均输出功率为350W,是超快薄盘振荡器功率走 向千瓦里程碑的重要一步。随着 SESAM 锁模技术的 成熟,激光波长逐步向长波长的新领域发展<sup>[40]</sup>。

固态激光器的性能在脉冲持续时间、平均功率、脉冲能量和脉冲重复率方面提高了几个数量级,对 SESAM的性能参数提出不同的要求。目前,SESAM 锁模TDL的输出功率大,要求SESAM具有大的饱和 通量和高的抗损伤阈值,如何在维持短脉冲的前提下 进一步提高SESAM的抗损伤能力是对SESAM锁模 TDL的考验。新一代SESAM将成为超快固态激光 振荡器进一步实现峰值功率缩放的关键推动者。

#### 4.2 SESAM锁模垂直外腔面发射激光器

SESAM 和垂直外腔面发射激光器(VECSEL)相结合,可得到功率高、光束质量好、基横模近衍射极限圆形光束和无调Q不稳定性的优质连续稳定锁模以及输出重复频率达数GHz的ps脉冲。高平均功率(高达瓦特范围)和高重复频率(数十千兆赫)的被动锁模VECSEL满足光学时钟和通信领域的应用要求<sup>[52]</sup>。SESAM和VECSEL有相同的半导体制造技术和生产设备,同时半导体激光器功率高,支持光泵浦和电泵 浦,可以通过带隙工程灵活控制发射波长,允许晶圆制造,也可以进一步将增益层和吸收层的外延结构高度 集成,高度紧凑和简单的外延结构,适用于低成本晶圆大规模生产。

2000年,Häring等<sup>[4]</sup>首次报道了SESAM被动锁 模二极管泵浦的VECSEL,SESAM和VECSEL的结 合给激光锁模提供了新方向。VECSEL大的增益界 面可以抑制调Q的不稳定,从而得到紧凑而高效的高 功率输出源和衍射极限的光束,具有极佳的应用价值。 2002年,Garnache等<sup>[53]</sup>采用金属有机物化学气相沉积 (MOCVD)在735℃的温度下生长短恢复时间的 SESAM,得到了首个fs量级的SESAM锁模二极管泵 浦的VECSEL。2004年,Lorenser等<sup>[52]</sup>将QD-SESAM集成到VECSEL的增益结构中,量子点可饱 和吸收区和VECSEL增益区有相同的模式面积即"1:1

#### 第 61 卷第 9 期/2024 年 5 月/激光与光电子学进展

锁模",QD-SESAM 首次使用相同的增益和吸收模式 区域实现稳定锁模,证明了 SESAM 和 VECSEL 集成 的可行性。2006年, Lorenser等<sup>[54]</sup>采用单层量子点的 低饱和通量 SESAM 锁模 VECSEL,将增益结构焊接 至易散热的金刚石散热器上,使输出功率最大化,重复 频率达到 50 GHz。基于 VECSEL 的超稳定千兆赫兹 频率梳对促进包括高精度光学频率计量和光谱学、生 物医学成像、光学相干层析成像和高速异步光学采样 在内的几种光学测量技术趋于成熟起着重要作用。 2008年, Hoffmann等<sup>[55]</sup>首次采用QD-SESAM成功锁 模垂直外腔表面发射激光器(QD-VECSEL),比标准 量子阱 SESAM 具有更大的设计自由度,通过去除衬 底优化 VECSEL 结构的散热性能,进一步提高激光器 的平均功率。2011年, Klopp等<sup>[56]</sup>利用降低泵浦功率 和提高 SESAM 温度的方式,在单脉冲条件下实现了 小于110 fs的脉冲。同年,Hoffmann等<sup>[57]</sup>首次实现了 输出功率大于1W的fs量级锁模, VECSEL和 SESAM 分别采用量子点材料作为有源区和吸收层, 优化器件结构,实现低的群延迟色散(GDD)和吸收区 快速恢复。量子点虽然饱和通量低,更易锁模,但是其 较长的恢复时间将限制脉冲宽度,而低温生长的量 子阱结构具有快的恢复时间和低的饱和通量。 2012年, Scheller 等<sup>[58]</sup>报道了平均功率高达 5.1 W的 fs 脉冲,通过 MOCVD 生长 VECSEL 并进行散热优化, 使器件适用于大功率输出。2013年,Wilcox等<sup>[59]</sup>报道 了一种去除衬底的近反谐振型量子阱 SESAM,利用 半导体表面的快速载流子重组和光学斯塔克效应实现 峰值功率达到 4.35 kW 的高峰值功率 fs 量级锁模。 2016年, Waldburger等<sup>[60]</sup>通过对VECSEL内量子阱位 置和表面涂层的设计,在SESAM锁模VECSEL中产 生高平均功率和短至100 fs以下的脉冲,是目前已报 道被动锁模半导体激光器的最短脉冲宽度。

表4展示了SESAM锁模光泵浦-VECSEL(OP-VECSEL)的部分重要参数。为了实现稳定的锁模, 通常采用折叠光路,目前应用较多的腔形结构有V形 和Z形,Z形参数更好控制,通过改变臂长几乎可以独 立地调整增益和吸收区的模式半径,但V形结构更简 单,也满足谐振腔稳定锁模的需求,所以往往以V形腔 为主。

2007年, Maas等<sup>[26]</sup>在增益区和吸收区采用不同的 生长温度,实现了低缺陷和高光学增益, 成功将增益层 和吸收层集成,制得锁模集成外腔表面发射激光器 (MIXSEL)。MIXSEL概念的简单性使千兆赫兹重复 频率的超快激光器更紧凑、更坚固、更经济, 从而降低 超快激光技术的应用成本。在MIXSEL的发展历程 中,其结构和理论得到逐步完善,性能也飞速提升, 在 表5中对MIXSEL各类参数进行了简要总结。

2010年, Rudin等<sup>[27]</sup>使用 MIXSEL 实现高功率超 短脉冲输出, 在反谐振结构中使用优化量子点吸收区,

|         | 表4    | SESAM 锁模 VECSEL 的发展                |
|---------|-------|------------------------------------|
| Table 4 | Devel | opment of SESAM mode-locked VECSEL |

| Reference | Gain material | Wavelength /nm | Pulse width /fs     | Average<br>power /mW                  | Repetition rate /<br>GHz | Peak power /<br>W    | Cavity type |
|-----------|---------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| [4]       | QW(InGaAs)    | 1030           | $22 \times 10^{3}$  | 21.6                                  | 4.4                      | 0.2                  | V           |
| [53]      | QW(InGaAs)    | 1040           | 477                 | 100                                   | 1.21                     | 152.5                | Ζ           |
| [54]      | QD(InAs)      | 958            | $3.3 \times 10^{3}$ | 102                                   | 50                       | 0.54                 | V           |
| [55]      | QD(InAs)      | 1060           | $18 \times 10^3$    | 27.4                                  | 2.57                     | 0.52                 | V           |
| [56]      | QWs(InGaAs)   | 1030           | 107                 | 3                                     | 5.1                      | 4.8                  | V           |
| [56]      | QD(InAs)      | 970            | 784                 | $1\!	imes\!10^{\scriptscriptstyle 3}$ | 5.4                      | 217.4                | V           |
| [58]      | QW(InGaAs)    | 1030           | 682                 | 5.1 $\times 10^{3}$                   | 1.7                      | $3.85 \times 10^{3}$ | V           |
| [59]      | QWs(InGaAs)   | 1013           | 400                 | 3.3 $\times 10^{3}$                   | 1.67                     | $4.35 \times 10^{3}$ | V           |
| [60]      | QW(InGaAs)    | 1034           | 96                  | 100                                   | 1.6                      | 560                  | V           |

# 表5 MIXSEL的发展

Table 5 Development of MIXSEL

| Reference | Gain material | Wavelength /nm | Pulse width /fs    | Average power /mW   | Repetition rate /GHz | Peak power /W |
|-----------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| [26]      | QD(InAs)      | 953            | $35 \times 10^{3}$ | 40                  | 2.8                  | 0.36          |
| [27]      | QD(InAs)      | 959            | $28 \times 10^{3}$ | $6.4 \times 10^{3}$ | 2.47                 | 80.2          |
| [61]      | QW(InGaAs)    | 968            | 620                | 101                 | 4.8                  | 29.9          |
| [62]      | QW(InGaAs)    | 964            | 570                | 127                 | 101.2                | 1.9           |
| [63]      | QW(InGaAs)    | 1040           | 253                | 235                 | 2.9                  | 240           |
| [63]      | QW(InGaAs)    | 1040           | 279                | 310                 | 10                   | 97            |
| [65]      | SQW(InGaAs)   | 1084           | 184                | 115                 | 4.33                 | 127           |
| [64]      | SQW(InGaAs)   | 1033           | 144                | 30                  | 2.73                 | 70            |

并通过去除晶圆衬底和将8 um 厚的 MIXSEL 直接安 装到金刚石散热器上的热管理方式,实现6.4 W的超 短脉冲输出,只有两个组件的简单直腔激光器产生了 高于任何其他模型锁模半导体激光器的平均功率。 2013年, Mangold 等<sup>[61]</sup>报道了第1个飞秒 MIXSEL, 利 用低温生长的单量子阱具有低饱和通量和快速恢复动 力学的特性得到 fs 量级 MIXSEL。次年, Mangold 等<sup>[62]</sup>报道了重复频率达到100 GHz以上的MIXSEL, 此为锁模半导体激光器的最高脉冲重复频率。实验利 用单个低温生长的量子阱实现低饱和通量和短恢复时 间的饱和吸收,同时采用低GDD的宽带增透界面进行 色散优化。通过机械地改变线性直腔和输出耦合器的 腔长,可支持从≈5 GHz到>100 GHz的脉冲重复频 率缩放。2015年, Mangold等<sup>[63]</sup>报道了迄今为止最高 峰值功率240W的MIXSEL,峰值功率首次可与传统 的 SESAM 锁模 VECSEL 相媲美。同时在 10 GHz 脉 冲重复频率下,获得平均输出功率为310mW的脉冲, 这是目前飞秒 MIXSEL 中最高的输出功率,通过不同 生长温度和生长方式生长外延片各结构、优化外延片 散热和更精准的色散控制等方式实现高功率输出。首 次对应变补偿的MIXSEL在不同的散热器温度、泵浦 功率和外延均匀性进行更详细的参数研究,详细地讨 论了如何平衡量子阱增益区和量子阱吸收区之间的临 界温度以及吸收器和外延生长质量对器件效率的影 响,为今后 MIXSEL 的优化提供有效指导。2018年, Alfieri等<sup>[64]</sup>报道 150 fs以下脉冲激光,通过优化多对介质涂层、应变补偿大带隙 AlAs<sub>x</sub>P<sub>1-x</sub>材料、非周期 InGaAs量子阱增益结构和热管理的方式获得了该脉 冲宽度新纪录。

除了以上的腔体结构,新的锁模结构被提出--环形腔中的碰撞脉冲锁模,利用这种腔体几何结构,两 个反向传播脉冲可在 SESAM 上同步, 使吸收器同时 达到饱和,从而最大限度地减少能量损失。该结构与 标准的V形腔相比,可以提高锁模稳定性,并提供更高 的输出功率。2016年,Laurain等<sup>[66]</sup>将半导体增益介质 和SESAM放置在环形腔中,实现了195 fs的脉冲持续 时间。每个输出光束的平均功率为225 mW,重复频 率为2.2 GHz,峰值功率为460 W。2017年, Laurain 等<sup>[67]</sup>报道了碰撞脉冲锁模 VECSEL,脉冲持续时间短 至 128 fs, 每 束 平 均 功 率 为 90 mW, 重 复 频 率 为 3.27 GHz, VECSEL采用双涂层介质获得宽的光谱带 宽以支持更短脉冲。2018年,Laurain等[68]通过模拟系 统对器件进行数值优化,再次报道了脉冲持续时间为 95 fs的碰撞锁模脉冲,在2.2 GHz重复频率下,实现 了每束输出功率为90mW的稳定碰撞脉冲锁模。

除了传统的光泵浦机制和器件结构,泵浦机制也 可采用电泵浦,器件结构也做出了膜系结构创新。电 泵浦 VECSEL<sup>[89]</sup>(EP-VECSEL)是一种高功率、高亮 度的半导体激光源,生产成本低,易于组装和集成到 光电器件中。2003年,Jasim等<sup>[70]</sup>报道了SESAM锁 模的EP-VECSEL,通过内腔锁模在980 nm处得到脉 冲宽度为57 ps、平均输出功率为40 mW、重复频率为 1.1 GHz的脉冲。这一报道引发了人们对不同激光设 计的进一步研究和脉冲参数改进<sup>[71-73]</sup>。2014年,Zaugg 等<sup>[74]</sup>在不同的腔结构中,报道了各类参数的最优数据, 即最短的脉冲宽度(2.5 ps)、最高的脉冲平均输出功 率(53.2 mW)、最高重复频率(18.2 GHz)和最高峰值 功率(4.7 W)。2019年,Chichkov等<sup>[75]</sup>报道了无 SESAM和其他反馈介质仍可实现自启动ps脉冲输出 的 EP-VECSEL,为未来 EP-VECSEL 的设计打开了 新局面。同时电泵浦技术和 MIXSEL 结构的结合也 是未来研究的新方向,该结构将使激光器锁模结构进 一步集成,这种潜力也使该激光技术更具吸引力。

在器件膜系结构方面,为了避免有源区因为吸收 多余泵浦热量而受到影响,Kahle等<sup>[76]</sup>提出了一种薄膜 外腔表面反射激光器(MECSEL)。MECSEL无需生 长DBR,由金刚石散热器夹着有源区组成,因此其在 材料和组分的选择上有更大的自由度,可以有效扩大 波长设计范围。2023年,Ćutuk等<sup>[77]</sup>提出一种新的可 饱和吸收装置,将可饱和吸收区从衬底中分离并放置 在介质端镜上,得到一种不受DBR反射率限制的薄膜 可饱和吸收镜(MESAM)。与SESAM锁模VECSEL 类似,MESAM在红光发射的VECSEL中实现了稳定 锁模,泵浦功率为4.25 W,脉冲持续时间为3.06 ps, 重复频率为812 MHz。

超快垂直外腔面发射激光器参数性能逐渐成熟, 脉冲持续时间已降低到100 fs以下,重复频率已达到 百GHz,峰值功率水平已在kW量级。巨大的波长灵 活性和紧凑的设计相比于其他类型超快激光器具有明 显生产优势,锁模半导体盘激光器的千兆赫兹工作状 态使它们非常有希望成为具有大梳齿间距和高功率单 模<sup>[62]</sup>的紧凑频率梳的来源,适用于诸如计量<sup>[78-79]</sup>、超稳 定光学时钟<sup>[80]</sup>和光谱学<sup>[81]</sup>等应用。目前的研究除了在 保持低的脉冲弛豫时间下增加器件的功率,平衡增益 材料和 SESAM之间的相互作用之外,还必须关注增 益和吸收材料的性能。未来设计在于提高效率,减少 热副作用并提高这些设备的可靠性,同时提升各类新 结构的参数。

#### 4.3 SESAM锁模光纤激光器

超快光纤激光器因其具有良好的空间光束质量、 紧凑性和易用性的优势,广泛应用于眼科、微机械加 工、医学成像和精密计量等各个领域<sup>[82-66]</sup>。相对于传 统固体激光器,光纤激光器具有效率高、可靠性高和占 地面积小的优点。

对于不同的激光波长,各种半导体材料应用范围 不同<sup>[87]</sup>。0.9~1 µm 的激光,SESAM采用 InGaAs作 为量子阱,GaAs/AlAs为布拉格反射镜,应用于锁模

#### 第 61 卷第 9 期/2024 年 5 月/激光与光电子学进展

掺镱(Yb)和钕(Nd)的光纤激光器<sup>[88-89]</sup>;1~1.3 μm 波 长范围,SESAM采用GaInNAs作为量子阱,GaAs/ AlAs为布拉格反射镜,锁模掺铋(Bi)激光器<sup>[90-91]</sup>;波长 1.5 μm及以上的激光器,通常使用InGaAs/InP布拉 格反射镜和InGaAs量子阱制成SESAM,应用于锁模 掺铒(Er)和铥(Tm)激光器<sup>[92-94]</sup>;波长2μm以上激光 器,SESAM采用GaInSb量子阱和AlAsSb/GaSb布拉 格反射镜,锁模掺铥(Tm)和钬(Ho)光纤激光器<sup>[95]</sup>。 SESAM的材料范围从GaN基材料到GaInAsSb基材 料,在选择激光发射波长方面提供了很大的灵活性<sup>[31]</sup>。

1993年,Ober等<sup>[96]</sup>首次报道了反谐振SESAM锁模 二极管泵浦Nd光纤激光器,脉冲持续时间低至260 fs, 实验中腔体设计比较复杂,需要与群延迟色散线和透 镜等结构结合。1996年, Sharp等<sup>[94]</sup>采用 MOCVD生 长 SESAM, 通过与激光器输出耦合器制成单片的方 式,实现掺Tm光纤激光器的耦合,获得脉冲宽度为 190 fs、重复频率为50 MHz、脉冲能量为20 pJ的超短 脉冲激光。2004年, Herda等<sup>[97]</sup>采用 MBE 生长的 SESAM 被动锁模掺 Yb 光纤激光器,在1036 nm 处获 得重复频率为80 MHz、脉冲宽度为11 ps的短脉冲激 光,使用高调制深度SESAM和无色散补偿激光可以 得到更紧凑稳定的锁模激光器,得到更简单的锁模光 纤激光。同年, Okhotnikov 等<sup>[83]</sup>利用近谐振 SESAM 在短光纤腔内实现激光器的稳定锁模,研究表明,近谐 振 SESAM 尤其适用于掺 Yb 光纤激光器。2006年, Herda 等<sup>[98]</sup>采用 QD-SESAM 锁模掺 Yb 光纤激光器, 高调制深度的 QD-SESAM 可实现快恢复时间,在 1042 nm 处获得平均功率为5 mW、脉冲宽度为2.8 ps 的超短脉冲输出。同年,Suomalainen等<sup>[99]</sup>利用晶格失 配引入非辐射复合中心来减少 SESAM 的恢复时间, 并采用 SESAM 作为掺 Yb 光纤激光腔中的端镜,在 1060 nm 处获得 2.3 ps 的锁模脉冲输出。2013年, Kim 等<sup>[100]</sup>采用MOCVD生长的量子阱SESAM锁模掺Yb 激光器,获得760 ps的脉冲。2022年,林楠等<sup>[10]</sup>采用 MOCVD 生长应变补偿量子阱结构的 SESAM,成功 锁模掺 Yb 光纤激光器并获得 18.3 ps 和 9.6 ps 的激光 脉冲输出。

除了以上报道的自制 SESAM 锁模光纤激光器,还 有较多商业 SESAM 锁模光纤激光器,如表 6 所示。 2009年,Tian等<sup>[102]</sup>通过激光腔的全正色散结构获得 4.3 nJ的高能量激光脉冲输出。2012年,Liu等<sup>[103]</sup>通过 窄带宽 SESAM 稳定锁模掺 Yb光纤激光器,获得高重 复频率激光。2016年,Hirooka等<sup>[104]</sup>采用高阶孤子效应 和 SESAM 相结合的方法锁模掺 Er 光纤激光器,在高 重复频率下获得超短脉冲激光。同年,Mashiko等<sup>[105]</sup>报 道了一种基于透镜系统色散的可调谐类噪声脉冲 (NLP),在 SESAM 锁模掺 Tm 光纤激光器中,通过优 化 SESAM 的位置,获得高功率输出。2018年,Hekmat 等<sup>[106]</sup>通过法拉第旋转镜缩短脉冲持续时间,使 SESAM 述

| 表6 近期商用SESAM锁模光纤激光器的发展 |
|------------------------|
|------------------------|

| Table 6 Development of recent commercial SESAM mode-locked fiber lasers |
|---|
|---|

| Year | Reference | Doped ion          | Wavelength /nm | Pulse width /fs      | Average power /mW | Repetition rate /MHz |
|------|-----------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2009 | [102]     | $Yb^{3+}$          | 1068           | 910                  | 1.7               | 397                  |
| 2012 | [103]     | $\mathrm{Yb}^{3+}$ | 1064           | $21 \times 10^{3}$   | 17                | 397                  |
| 2016 | [104]     | $\mathrm{Er}^{3+}$ | 1560           | 440                  | 15                | 9.2 $\times 10^{3}$  |
| 2016 | [105]     | $Tm^{3+}$          | 1928           | 280                  | 195               | 20.5                 |
| 2018 | [106]     | $\mathrm{Er}^{3+}$ | 1550           | 135                  | 45                | 23.5                 |
| 2021 | [107]     | $\mathrm{Er}^{3+}$ | 1561           | $3.86 \times 10^{3}$ | 241               | $4.95 \times 10^{3}$ |

锁模光纤激光器获得超短的脉冲输出。2021年,Gao 等<sup>[107]</sup>通过限制光纤长度和使用较低调制深度的 SESAM获得高重复频率的SESAM。

总的来说,应用于光纤激光器的SESAM要求短的恢复时间、较高的调制深度,从而达到光纤激光器实现短脉冲输出的目的,更好地发挥光纤激光器短脉冲宽度的优势,同时随着器件性能的提升,激光性能也逐渐向高重复频率和高输出功率方向发展。从近期SESAM锁模光纤激光器的报道来看,主要为商用的SESAM,以德国BATOP公司的应用最广泛,该公司的SESAM产品参数范围广泛,锁模稳定性好,商业化成功。因此加快国内SESAM的研制对打破商业垄断具有重要意义。目前超快光纤系统存在的挑战除了SESAM本身的商业垄断之外,还包括光纤技术的改进,例如功率的缩放、光纤系统的成本以及光束能量的增加。

## 5 结 论

SESAM在各类激光器的锁模应用中达到了比较 成熟的水平,其锁模的激光器在科学和工业领域广泛 应用。一般情况下,无论是固体激光器、垂直外腔表面 发射激光器还是光纤激光器,要获得更窄的脉冲宽度、 更高的脉冲能量以及稳定锁模都要求SESAM拥有短 的恢复时间、高的损伤阈值和长的使用寿命。然而,这 3种激光器对SESAM的吸收率、调制深度和饱和通量 的要求却不相同,固体激光器要求 SESAM 的吸收率 在0.7%~3%之间、调制深度较小,反谐振型结构更 容易实现较小调制深度,饱和通量约为120 μJ/cm<sup>2</sup>。 垂直外腔表面发射激光器要求 SESAM 具有低的饱和 通量同时具有快的恢复时间,通常采用低温生长的单 量子阱构成反谐振结构,与应用于固体激光器内的 SESAM类似。光纤激光器要求 SESAM 的吸收率在 20%~40%、调制深度较大,谐振型结构更容易实现较 大调制深度,饱和通量约为30 µJ/cm<sup>2</sup>。

在固体激光器的锁模应用中,基本上完成了对 SESAM器件关键参数及其影响条件的探索,明确了 SESAM的弛豫时间、调制深度、损伤阈值、饱和通量 等参数对超快激光器性能的影响。同时在SESAM与 固体激光器的结合中也将固体激光器的性能提升了几 个数量级。在与VECSEL的锁模应用中,不仅性能水 平逐渐提高,也完成了高度集成器件,同时提出了新型 膜系器件。在光纤激光器锁模中,除了得到短的脉冲 宽度输出,同时还获得了以往光纤激光器未达到的高 重复频率激光输出。随着SESAM器件性能的提升和 商业化,超快激光器的获取会越来越容易。将会开发 出更小、更便宜、效率更高的超快激光,更广泛地应用 于各个领域。未来对超快激光器的改进也将着重在扩 宽超快激光波长范围、提高效率,减少热副作用,提高 器件的可靠性等方面。

#### 参考文献

 舒强,舒永春,刘如彬,等.半导体可饱和吸收镜实现 超短高功率脉冲激光研究进展[J].激光与红外,2007, 37(3):197-199,210.
 Shu Q, Shu Y C, Liu R B, et al. Development of semiconductor saturable absorption mirror used for high

average output power ultrashort pulses laser[J]. Laser & Infrared, 2007, 37(3): 197-199, 210.

- [2] Keller U, Miller D A, Boyd G D, et al. Solid-state lowloss intracavity saturable absorber for Nd: YLF lasers: an antiresonant semiconductor Fabry-Perot saturable absorber [J]. Optics Letters, 1992, 17(7): 505-507.
- [3] de Souza E A, Soccolich C E, Pleibel W, et al. Saturable absorber modelocked polarisation maintaining erbium-doped fibre laser[J]. Electronics Letters, 1993, 29 (5): 447-449.
- [4] Häring R, Paschotta R, Morier-Genoud F, et al. Passively mode-locked diode-pumped surface-emitting semiconductor laser[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2000, 12(9): 1135-1137.
- [5] Spence D E, Kean P N, Sibbett W. 60-fsec pulse generation from a self-mode-locked Ti: sapphire laser[J]. Optics Letters, 1991, 16(1): 42-44.
- [6] Keller U. Recent developments in compact ultrafast lasers[J]. Nature, 2003, 424(6950): 831-838.
- [7] 周炳琨,高以智,陈倜嵘,等.激光原理[M].5版.北京:国防工业出版社,2004:234.
  Zhou B K, GAO Y Z, CHEN T R, et al. Laser principle [M]. 5th ed. Beijing: National Defense Industry Press, 2004:234.
- [8] Brovelli L R, Keller U, and Chiu T H. Design and operation of antiresonant Fabry-Perot saturable semiconductor absorbers for mode-locked solid-state

#### 综 述

lasers[J]. Journal of the Optical Society of America, 1995, 12(2): 311-322.

- Keller U, Chiu T H, Ferguson J F. Self-starting and self-Q-switching dynamics of passively mode-locked Nd: YLF and Nd: YAG lasers[J]. Optics Letters, 1993, 18 (3): 217-219.
- [10] Kärtner F X, Brovelli L R, Kopf D, et al. Control of solid state laser dynamics by semiconductor devices[J]. Optical Engineering, 1995, 34(7): 2024-2036.
- [11] Fluck R, Jung I D, Zhang G, et al. Broadband saturable absorber for 10-fs pulse generation[J]. Optics Letters, 1996, 21(10): 743-745.
- [12] 张志刚,柴路,赵江山,等.用于钛宝石激光器自启动 锁模的半导体可饱和吸收镜[J].光学学报,2002,22(9): 1151-1152.
  Zhang Z G, Chai L, Zhao J S, et al. Semiconductor saturable-absorber mirror for self-starting mode-locked Ti : Sapphire lasers[J]. Acta Optica Sinica, 2002, 22(9): 1151-1152.
- [13] Keller U. Ultrafast solid-state laser oscillators: a success story for the last 20 years with no end in sight[J]. Applied Physics B, 2010, 100(1): 15-28.
- [14] Fluck R, Weingarten K J, Moser M, et al. Diodepumped passively mode-locked 1.3- μm Nd:YVO<sub>4</sub> and Nd:YLF lasers by use of semiconductor saturable absorbers[J]. Optics Letters, 1996, 21(17): 1378-1380.
- [15] Jung I D, Kärtner F X, Matuschek N, et al. Semiconductor saturable absorber mirrors supporting sub-10-fs pulses[J]. Applied Physics B, 1997, 65(2): 137-150.
- [16] Grange R, Schön S, Liverini V, et al. A low-loss and low-saturation-fluence GaInNAs SESAM for ultrafast 1.3- μm solid-state lasers[C]//Advanced Solid-State Photonics, February 1-4, 2004, Santa Fe, New Mexico. Washington, D. C.: Optica Publishing Group, 2004: WE3.
- [17] Spühler G J, Weingarten K J, Grange R, et al. Semiconductor saturable absorber mirror structures with low saturation fluence[J]. Applied Physics B, 2005, 81 (1): 27-32.
- [18] Fluck R, Braun B, Gini E, et al. Passively Q-switched 1.34- μm Nd:YVO<sub>4</sub> microchip laser with semiconductor saturable-absorber mirrors[J]. Optics Letters, 1997, 22 (13): 991-993.
- [19] Marchese S V, Baer C R, Engqvist A G, et al. Femtosecond thin disk laser oscillator with pulse energy beyond the 10-microjoule level[J]. Optics Express, 2008, 16(9): 6397-6407.
- [20] Saraceno C J, Schriber C, Mangold M, et al. SESAMs for high power oscillators: damage thresholds and design guidelines[C]//CLEO: 2011-Laser Applications to Photonic Applications, May 1-6, 2011, Baltimore, Maryland. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 2011: CFO1.
- [21] Saraceno C J, Hoffmann M, Schriber C, et al. SESAMs for high-power femtosecond modelocking: influence of growth temperature on damage and nonsaturable losses [C]//Lasers, Sources, and Related Photonic Devices, 29

January-1 February, 2012, San Diego, California. Washington, D. C.: Optica Publishing Group, 2012: AM4A.13.

- [22] Alfieri C G E, Diebold A, Emaury F, et al. Improved SESAMs for femtosecond pulse generation approaching the kW average power regime[J]. Optics Express, 2016, 24(24): 27587-27599.
- [23] Alfieri C G E, Diebold A, Kopp M, et al. SESAMs for high-power lasers[C]//Conference on Lasers and Electro-Optics, June 5-10, 2016, San Jose, California. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 2016: SM1I.5.
- [24] Unold H J, Lorenser D, Maas D J H C, et al. Towards wafer-scale integration of high-repetition-rate passively mode-locked surface-emitting semiconductor lasers[C]// Conference on Lasers and Electro-Optics, May 22-27, 2005.
- [25] Maas D J H C, Bellancourt A R, Rudin B, et al. MIXSELs-a new class of ultrafast semiconductor lasers [C]//2007 European Conference on Lasers and Electro-Optics and the International Quantum Electronics Conference, June 17-22, 2007, Munich, Germany. New York: IEEE Press, 2007.
- [26] Maas D J H C, Bellancourt A R, Rudin B, et al. Vertical integration of ultrafast semiconductor lasers[J]. Applied Physics B, 2007, 88(4): 493-497.
- [27] Rudin B, Wittwer V J, Maas D J H C, et al. Highpower MIXSEL: an integrated ultrafast semiconductor laser with 6.4 W average power[J]. Optics Express, 2010, 18(26): 27582-27588.
- [28] Finke T, Nürnberg J, Sichkovskyi V, et al. Temperature resistant fast In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As/GaAs quantum dot saturable absorber for the epitaxial integration into semiconductor surface emitting lasers[J]. Optics Express, 2020, 28(14): 20954-20966.
- [29] Diebold A, Zengerle T, Mangold M, et al. Optimized SESAMs for kilowatt ultrafast lasers[C]//CLEO: 2015, May 10-15, 2015, San Jose, California. Washington, D. C.: Optica Publishing Group, 2015: STu1O.5.
- [30] Diebold A, Zengerle T, Alfieri C G E, et al. Optimized SESAMs for kilowatt-level ultrafast lasers[J]. Optics Express, 2016, 24(10): 10512-10526.
- [31] Keller U. Ultrafast solid-state lasers[C]//Conference Digest. 2000 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe (Cat. No. 00TH8505), September 10-15, 2000, Nice, France. New York: IEEE Press, 2007.
- [32] Baer C R E, Heckl O H, Saraceno C J, et al. Frontiers in passively mode-locked high-power thin disk laser oscillators[J]. Optics Express, 2012, 20(7): 7054-7056.
- [33] der Au J A, Spühler G J, Südmeyer T, et al. 16.2-W average power from a diode-pumped femtosecond Yb: YAG thin disk laser[J]. Optics Letters, 2000, 25(11): 859-861.
- [34] Innerhofer E, Südmeyer T, Brunner F, et al. 60-W average power in 810-fs pulses from a thin-disk Yb:YAG laser[J]. Optics Letters, 2003, 28(5): 367-369.
- [35] Saraceno C J, Heckl O H, Baer C R E, et al. Sub-100 femtosecond pulses from a SESAM modelocked thin disk

#### 综 述

laser[J]. Applied Physics B, 2012, 106(3): 559-562.

- [36] Diebold A, Emaury F, Schriber C, et al. SESAM modelocked Yb:CaGdAlO<sub>4</sub> thin disk laser with 62 fs pulse generation[J]. Optics Letters, 2013, 38(19): 3842-3845.
- [37] Schriber C, Emaury F, Diebold A, et al. Dual-gain SESAM modelocked thin disk laser based on Yb:  $Lu_2O_3$  and Yb:  $Sc_2O_3[J]$ . Optics Express, 2014, 22(16): 18979-18986.
- [38] Saraceno C J, Emaury F, Schriber C, et al. Ultrafast thin-disk laser with 80 μJ pulse energy and 242 W of average power[J]. Optics Letters, 2013, 39(1): 9-12.
- [39] Saltarelli F, Graumann I J, Lang L, et al. Power scaling of ultrafast oscillators: 350-W average-power subpicosecond thin-disk laser[J]. Optics Express, 2019, 27 (22): 31465-31474.
- [40] Tomilov S, Hoffmann M, Heidrich J, et al. High-power Ho: YAG thin-disk laser and first SESAM modelocking [C]//Laser Congress 2020 (ASSL, LAC), October 13-16, 2020, Washington, D. C.. Washington, D. C.: Optica Publishing Group, 2020: AW5A.2.
- [41] Saraceno C J, Emaury F, Heckl O H, et al. 275 W average output power from a femtosecond thin disk oscillator operated in a vacuum environment[J]. Optics Express, 2012, 20(21): 23535-23541.
- [42] Bauer D, Zawischa I, Sutter D H, et al. Mode-locked Yb: YAG thin-disk oscillator with 41 μJ pulse energy at 145 W average infrared power and high power frequency conversion[J]. Optics Express, 2012, 20(9): 9698-9704.
- [43] Wentsch K S, Zheng L H, Xu J, et al. Passively modelocked Yb<sup>3+</sup>: Sc<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> thin-disk laser[J]. Optics Letters, 2012, 37(22): 4750-4753.
- [44] Ricaud S, Jaffres A, Wentsch K, et al. Femtosecond Yb
   :CaGdAlO<sub>4</sub> thin-disk oscillator[J]. Optics Letters, 2012, 37(19): 3984-3987.
- [45] Greborio A, Guandalini A, der Au J A. Sub-100 fs pulses with 12.5-W from Yb: CALGO based oscillators[J]. Proceedings of SPIE, 2012, 8235: 823511.
- [46] Graumann I J, Diebold A, Emaury F, et al. Peak-power scaling of femtosecond SESAM-modelocked Yb:Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> thin-disk lasers[C]//2017 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC), June 25-29, 2017, Munich, Germany. New York: IEEE Press, 2017.
- [47] Meyer F, Hekmat N, Mansourzadeh S, et al. Optical rectification of a 100 W average power mode-locked thindisk oscillator[J]. Optics Letters, 2018, 43(24): 5909-5912.
- [48] Beirow F, Eckerle M, Dannecker B, et al. Radially polarized passively mode-locked thin-disk laser oscillator emitting sub-picosecond pulses with an average output power exceeding the 100 W level[J]. Optics Express, 2018, 26(4): 4401-4410.
- [49] Saltarelli F, Diebold A, Graumann I J, et al. Self-phase modulation cancellation in a high-power ultrafast thindisk laser oscillator[J]. Optica, 2018, 5(12): 1603-1606.
- [50] Tomilov S, Hoffmann M, Heidrich J, et al. SESAMmodelocked Ho: YAG thin-disk laser with 40.5 W of

average power[C]//Conference on Lasers and Electro-Optics, May 9-14, 2021, San Jose, California. Washington, D. C.: Optica Publishing Group, 2021: SF2M.3.

- [51] Tomilov S, Wang Y C, Hoffmann M, et al. 50-W average power Ho:YAG SESAM-modelocked thin-disk oscillator at 2.1 μm[J]. Optics Express, 2022, 30(15): 27662-27673.
- [52] Lorenser D, Unold H J, Maas D J H C, et al. Towards wafer-scale integration of high repetition rate passively mode-locked surface-emitting semiconductor lasers[J]. Applied Physics B, 2004, 79(8): 927-932.
- [53] Garnache A, Hoogland S, Tropper A C, et al. Sub-500fs soliton-like pulse in a passively mode-locked broadband surface-emitting laser with 100 mW average power[J]. Applied Physics Letters, 2002, 80(21): 3892-3894.
- [54] Lorenser D, Maas D J H C, Unold H J, et al. 50-GHz passively mode-locked surface-emitting semiconductor laser with 100-mW average output power[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2006, 42(8): 838-847.
- [55] Hoffmann M, Barbarin Y, Maas D J H C, et al. Modelocked quantum dot vertical external cavity surface emitting laser[J]. Applied Physics B, 2008, 93(4): 733-736.
- [56] Klopp P, Griebner U, Zorn M, et al. Pulse repetition rate up to 92 GHz or pulse duration shorter than 110 fs from a mode-locked semiconductor disk laser[J]. Applied Physics Letters, 2011, 98(7): 071103.
- [57] Hoffmann M, Sieber O D, Wittwer V J, et al. Femtosecond high-power quantum dot vertical external cavity surface emitting laser[J]. Optics Express, 2011, 19 (9): 8108-8116.
- [58] Scheller M, Wang T L, Kunert B, et al. Passively modelocked VECSEL emitting 682 fs pulses with 5.1 W of average output power[J]. Electronics Letters, 2012, 48 (10): 588-589.
- [59] Wilcox K G, Tropper A C, Beere H E, et al. 4.35 kW peak power femtosecond pulse mode-locked VECSEL for supercontinuum generation[J]. Optics Express, 2013, 21(2): 1599-1605.
- [60] Waldburger D, Link S M, Alfieri C G E, et al. Highpower 100-fs SESAM-modelocked VECSEL[C]// Lasers Congress 2016 (ASSL, LSC, LAC), October 30-November 3, 2016, Boston, Massachusetts. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 2016: ATu1A.8.
- [61] Mangold M, Wittwer V J, Zaugg C A, et al. Femtosecond pulses from a modelocked integrated external-cavity surface emitting laser (MIXSEL) [J]. Optics Express, 2013, 21(21): 24904-24911.
- [62] Mangold M, Zaugg C A, Link S M, et al. Pulse repetition rate scaling from 5 to 100 GHz with a highpower semiconductor disk laser[J]. Optics Express, 2014, 22(5): 6099-6107.
- [63] Mangold M, Golling M, Gini E, et al. Sub-300femtosecond operation from a MIXSEL[J]. Optics Express, 2015, 23(17): 22043-22059.
- [64] Alfieri C G E, Waldburger D, Nürnberg J, et al. Sub-

#### 综 述

150-fs pulses from an optically pumped broadband modelocked integrated external-cavity surface emitting laser[J]. Optics Letters, 2018, 44(1): 25-28.

- [65] Alfieri C G E, Waldburger D, Link S M, et al. Optical efficiency and gain dynamics of modelocked semiconductor disk lasers[J]. Optics Express, 2017, 25(6): 6402-6420.
- [66] Laurain A, Marah D, Rockmore R, et al. Colliding pulse mode locking of vertical-external-cavity surfaceemitting laser[J]. Optica, 2016, 3(7): 781-784.
- [67] Laurain A, Rockmore R, Chan H T, et al. Pulse interactions in a colliding pulse mode-locked vertical external cavity surface emitting laser[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2017, 34(2): 329-337.
- [68] Laurain A, Kilen I, Hader J, et al. Modeling and experimental realization of modelocked VECSEL producing high power sub-100 fs pulses[J]. Applied Physics Letters, 2018, 113(12): 121113.
- [69] McInerney J G, Mooradian A, Lewis A, et al. Highpower surface emitting semiconductor laser with extended vertical compound cavity[J]. Electronics Letters, 2003, 39(6): 523-525.
- [70] Jasim K, Zhang Q A, Nurmikko A V, et al. Passively modelocked vertical extended cavity surface emitting diode laser[J]. Electronics Letters, 2003, 39(4): 373-375.
- [71] Pallmann W P, Zaugg C A, Mangold M, et al. Gain characterization and passive modelocking of electrically pumped VECSELs[J]. Optics Express, 2012, 20(22): 24791-24802.
- [72] Pallmann W P, Zaugg C A, Mangold M, et al. Ultrafast electrically pumped VECSELs[J]. IEEE Photonics Journal, 2013, 5(4): 1501207.
- [73] Alhazime A, Butkus M, Hamilton C J, et al. 216 MHz repetition rate passively mode-locked electrically-pumped VECSEL[J]. Proceedings of SPIE, 2014, 8966: 89660K.
- [74] Zaugg C A, Gronenborn S, Moench H, et al. Absorber and gain chip optimization to improve performance from a passively modelocked electrically pumped vertical external cavity surface emitting laser[J]. Applied Physics Letters, 2014, 104(12): 121115.
- [75] Chichkov N B, Yadav A, Munshi T, et al. Pulse dynamics in SESAM-free electrically-pumped VECSEL [C]//2019 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC), June 23-27, 2019, Munich, Germany. New York: IEEE Press, 2019.
- [76] Kahle H, Mateo C M N, Brauch U, et al. Semiconductor membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL)[J]. Optica, 2016, 3(12): 1506-1512.
- [77] Ćutuk A, Grossmann M, Jetter M, et al. Membrane saturable absorber mirror (MESAM) in a red-emitting VECSEL for the generation of stable ultrashort pulses[J]. Optics Express, 2023, 31(4): 6796-6804.
- [78] Telle H R, Steinmeyer G, Dunlop A E, et al. Carrierenvelope offset phase control: a novel concept for absolute optical frequency measurement and ultrashort pulse generation[J]. Applied Physics B, 1999, 69(4): 327-332.

- [79] Steinmetz T, Wilken T, Araujo-Hauck C, et al. Laser frequency combs for astronomical observations[J]. Science, 2008, 321(5894): 1335-1337.
- [80] Udem T, Holzwarth R, Hänsch T W. Optical frequency metrology[J]. Nature, 2002, 416(6877): 233-237.
- [81] Coddington I, Swann W, Newbury N. Coherent multiheterodyne spectroscopy using stabilized optical frequency combs[J]. Physical Review Letters, 2008, 100 (1): 013902.
- [82] Vazquez-Zuniga L A, Jeong Y. Wavelength-tunable, passively mode-locked erbium-doped fiber masteroscillator incorporating a semiconductor saturable absorber mirror[J]. Journal of the Optical Society of Korea, 2013, 17(2): 117-129.
- [83] Okhotnikov O G, Grudinin A B, Pessa M. Ultra-fast fibre laser systems based on SESAM technology: new horizons and applications[J]. New Journal of Physics, 2004, 6: 177.
- [84] Richardson D J, Nilsson J, Clarkson W A. High power fiber lasers: current status and future perspectives[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2010, 27 (11): B63-B92.
- [85] Jauregui C, Limpert J, Tünnermann A. High-power fibre lasers[J]. Nature Photonics, 2013, 7(11): 861-867.
- [86] Kalaycıoğlu H, Elahi P, Akçaalan Ö, et al. High-repetition-rate ultrafast fiber lasers for material processing
   [J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2018, 24(3): 8800312.
- [87] Fermann M E, Hartl I. Ultrafast fibre lasers[J]. Nature Photonics, 2013, 7(11): 868-874.
- [88] Rusu M, Karirinne S P, Guina M, et al. Femtosecond neodymium-doped fiber laser operating in the 894- to 909-nm spectral range[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2004, 16(4):1029-1031.
- [89] Price J H V, Lefort L, Richardson D J, et al. A practical, low-noise, stretched-pulse Yb<sup>3+</sup>-doped fiber laser[C]//Technical Digest. Summaries of papers presented at the Conference on Lasers and Electro-Optics, May 11, 2001, Baltimore, MD, USA. New York: IEEE Press, 2002: 291-293.
- [90] Rutz A, Liverini V, Grange R, et al. Parameter tunable GaInNAs saturable absorbers for mode locking of solidstate lasers[J]. Journal of Crystal Growth, 2007, 301/ 302: 570-574.
- [91] Kivisto S, Puustinen J, Guina M, et al. Tunable modelocked bismuth-doped soliton fibre laser[J]. Electronics Letters, 2008, 44(25): 1456-1458.
- [92] de Souza E A, Soccolich C E, Pleibel W, et al. Saturable absorber modelocked polarisation maintaining erbium-doped fibre laser[J]. Electronics Letters, 1993, 29 (5): 447-449.
- [93] Jiang M, Sucha G, Fermann M E, et al. Nonlinearly limited saturable-absorber mode locking of an erbium fiber laser[J]. Optics Letters, 1999, 24(15): 1074-1076.
- [94] Sharp R C, Spock D E, Pan N, et al. 190-fs passively mode-locked thulium fiber laser with a low threshold[J]. Optics Letters, 1996, 21(12): 881-883.

#### 综 述

- [95] Gumenyuk R, Vartiainen I, Tuovinen H, et al. Dissipative dispersion-managed soliton 2 μm thulium/ holmium fiber laser[J]. Optics Letters, 2011, 36(5): 609-611.
- [96] Ober M H, Keiler U, Chiu T H, et al. Self-starting diode-pumped femtosecond Nd fiber laser[J]. Optics Letters, 1993, 18(18): 1532-1534.
- [97] Herda R, Okhotnikov O G. Dispersion compensationfree fiber laser mode-locked and stabilized by a highcontrast saturable absorber mirror[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2004, 40(7): 893-899.
- [98] Herda R, Okhotnikov O G, Rafailov E U, et al. Semiconductor quantum-dot saturable absorber modelocked fiber laser[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2006, 18(1): 157-159.
- [99] Suomalainen S, Guina M, Hakulinen T, et al. 1 μm saturable absorber with recovery time reduced by lattice mismatch[J]. Applied Physics Letters, 2006, 89(7): 071112.
- [100] Kim M J, Kim H S, Kim N S, et al. Investigation of InGaAs quantum-well parameters of a semiconductor saturable absorber mirror used for mode locking of a Ybdoped fiber laser[J]. Journal of the Korean Physical Society, 2013, 63(10): 1919-1924.
- [101] 林楠,仲莉,黎海明,等.应变补偿多量子阱结构半导体可饱和吸收镜[J].中国激光,2022,49(11):1101002.
   Lin N, Zhong L, Li H M, et al. Strain-compensated multi-quantum well structure semiconductor saturable

absorption mirror[J]. Chinese Journal of Lasers, 2022, 49 (11): 1101002.

- [102] Tian X L, Tang M, Shum P P, et al. High-energy laser pulse with a submegahertz repetition rate from a passively mode-locked fiber laser[J]. Optics Letters, 2009, 34(9): 1432-1434.
- [103] Liu J, Xu J, Wang P. High repetition-rate narrow bandwidth SESAM mode-locked Yb-doped fiber lasers
   [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2012, 24(7): 539-541.
- [104] Hirooka T, Tokuhira K, Yoshida M, et al. 440 fs, 9.2 GHz regeneratively mode-locked erbium fiber laser with a combination of higher-order solitons and a SESAM saturable absorber[J]. Optics Express, 2016, 24(21): 24255-24264.
- [105] Mashiko Y, Fujita E, Tokurakawa M. Tunable noiselike pulse generation in mode-locked Tm fiber laser with a SESAM[J]. Optics Express, 2016, 24(23): 26515-26520.
- [106] Hekmat M J, Gholami A, Omoomi M, et al. Ultra-short pulse generation in a linear femtosecond fiber laser using a Faraday rotator mirror and semiconductor saturable absorber mirror[J]. Laser Physics Letters, 2018, 15(2): 025101.
- [107] Gao X B, Zhao Z G, Cong Z H, et al. Stable 5-GHz fundamental repetition rate passively SESAM modelocked Er-doped silica fiber lasers[J]. Optics Express, 2021, 29(6): 9021-9029.